

【19】中華民國

【12】發明公開公報 (A)

【11】公開編號：200427979

申請實體審查：有

【43】公開日：中華民國93(2004)年12月16日

【51】國際專利分類 Int. Cl.⁷：G01N21/84

【54】發明名稱：原位式奈米壓印微影技術之模具變形監測的方法與系統

【21】申請案號：092114912

【22】申請日：中華民國92(2003)年6月2日

【72】發明人：賀陳弘；粘金重

【71】申請人：賀陳弘

新竹市建中路一〇〇之十九號

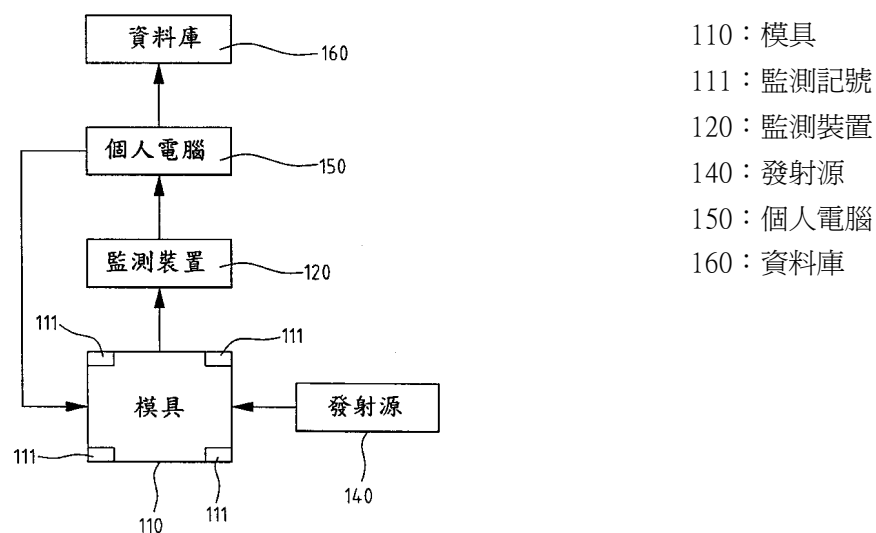
粘金重

新竹市明湖路六四八巷一〇二弄五十九號

【74】代理人：洪堯順

【57】發明摘要

本發明提供一種即時監測奈米壓印微影技術之模具形變的方法，其中該方法使用一資料庫，用以記錄暫時性資料，同時利用在該壓印微影技術之模具上製作監測記號，並在該壓印微影技術之模具的周圍設置發射源與監測裝置，以進行下列步驟：(A)在奈米壓印所使用的模具本體之較易觀測的位置，製作監測模具變形所需之記號；(B)裝設發射源與監測裝置，以偵測模具之監測記號的變形量；(C)將上述偵測之變形量，轉換為輸出信號輸入至個人電腦處理，而個人電腦處理之暫時性資料則藉由資料庫加以記錄；(D)憑藉步驟(C)個人電腦處理之信號，發出控制訊號，以控制模具是否停止或令機台發出警報訊號。



代表圖式